



日本国特許庁 岩井良行長官 殿

拝啓 初夏の候、貴庁益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

私たち知的財産問題研究グループ（Intellectual Property Group：IPG）は、模倣品や海賊版といった権利侵害など知的財産権に関する問題に対処するため、情報交換の場として、さらに現地政府との協力活動を行う母体として発足いたしました。現在、北京 IPG（2000 年 5 月設立）、上海 IPG（2002 年 9 月設立）、広東 IPG（2005 年 8 月設立）の 3 拠点で活動を行っています。

IPG は、参加する企業／団体のビジネス活動の最前線である中国の現場において、全てのメンバー企業／団体が主体となり、各々が有する知的財産権の保護のみならず、中国の経済発展と全世界の消費者保護のため、積極的に知的財産に関する課題の解決に取り組み、更なる中日友好関係の構築を目指しています。

今般、IPG にて貴庁に対する要望をまとめましたので、提出いたします。貴庁における今後の政策立案において、是非、ご考慮いただきますようお願いいたします。なお、今回の意見は、経済産業構造審議会知的財産政策部会の開催予定である 7 月前に提出すべきと考えましたので、北京 IPG 戦略委員会、上海 IPG 幹事会、広東 IPG 幹事会にて意見を取りまとめました。

敬具

2011 年 6 月 30 日
中国知的財産問題研究グループ

中国における知的財産制度の現状と課題について

2011 年 6 月

中国における知的財産制度の改善に向けた要望（ポイント）

- ◆ 中国における知的財産制度は、「研究開発成果・ブランドの適切な保護」及び「適切な権利活用」が重要である。
- ◆ 中国の法律・法規の改正が必要な事項については、日中政府間における継続した交渉をお願いしたい。他方、中国政府の運用改善、日本政府自身の代替策で対応が可能な事項については、優先的な解決を希望する。
- ◆ 日本政府が主体となって、中国国民に対する普及啓発活動を実施していただきたい。
- ◆ 日中のハイレベル政策対話の機会をより一層活用し、具体的な知的財産問題を議論していただきたい。

1 中国の政策と現状

（１）中国の長期的な方針

中国では、第十一次及び第十二次五カ年計画において「自主創新」¹の能力向上を国の方針としている。これは、

- ・ 中国市場を外資に開放したが、国際的な民族系企業が出ていない。
- ・ 労働賃金の上昇により、安価な労働力を用いた低コスト競争はもはや維持できない。
- ・ 技術力の高い外資企業が利益の大部分を獲得している。

ことを踏まえ、産業構造を労働集約型から知識集約型へ転換し、中国の国際競争力を高めるためには、研究開発能力を高めることが必須と考えているからである。そして、自主創新の主体として企業を位置づけ、企業の研究開発能力の向上を図るべく、財政・税収・金融等の支援を積極的に行っている。特に GDP に占める研究開発費の割合については、2020 年までに 2.5%以上とすることを目標としている²。

¹ 「自主創新」とは、国家創新能力を増強することであり、また原始創新、集成創新を強化し、技術を導入し、消化し、吸収し、再創新を強化することという。（出典：「国家中長期科学技術發展規画綱要」（2006 年 2 月 9 日公表））

² 国家中長期科学技術發展規画綱要

（２）国家知識産権局の方針

自主創新能力の向上のため、国家知識産権局（SIPO）は「全国専利事業發展戰略（2011－2020 年）」（2010 年 11 月 17 日公表）を策定し、2015 年の目標として以下を掲げている。なお、括弧書きの数字は現状である。

- ・ 発明、実用新案、意匠の年間出願件数 200 万件（特許 391,177、実用 409,836、意匠 421,273）
- ・ 中国人の発明専利年間授權件数 世界第二位（79,767 件）
- ・ 100 万人当たりの特許保有件数 倍増（422 件）³
- ・ 海外特許出願件数 倍増（11,244 件）⁴

ただし、特許出願件数が増えただけでは産業構造の転換にはつながらない。そのため、特許権の産業化や譲渡・ライセンスを積極的に進め、知財を担保とした融資制度の整備にも取り組んでいる。

（３）国家工商行政管理総局の方針

中国企業の市場競争力を高めるためには、国際的な評価の高いブランドの創設も重要である。そのため、国家工商行政管理総局（SAIC）は「国家知識産権戰略綱要の徹底的な履行による商標戰略実施の強力な推進に関する意見」（2009 年 6 月 2 日公表）、「国家工商行政管理総局による商標事業の世界水準達成の計画（2008 年～2012 年）」（2009 年 11 月 25 日公表）を策定し、中国企業の国内・国外における商標登録件数の増加を目指すとともに、2012 年までに商標審査期間を 10 か月以内に短縮するとした。なお中国では、2010 年に 1,072,187 件の商標出願があったものの、商標審査期間は 12 か月まで短縮されている。

（４）権利紛争の現状

特許権及び商標権が増加するに伴い、人民法院における侵害訴訟も増加している。全国の人民法院が受理した知的財産関連訴訟（第一審）は、特許権侵害訴訟が 5,785 件（前年比 30.82%増）、商標権侵害訴訟が 8,460 件（前年比 22.50%増）である。また、市場經濟の正常な秩序を乱し、企業の競争力及びイノベーションに対する積極性を妨害するとともに、中国の国際的イメージに傷をつけている模倣品問題を改善するため、國務院は「知的財産権の侵害及び模倣品・粗悪品の製造・販売を摘発する特別プロジェクト活動」（2010 年 10 月 27 日公表）を展開している。

³ 第 6 次全国人口調査による大陸 31 の省・自治区・直轄市の総人口は 1,339,724,852 人。2010 年末の有効な特許権数は 564,760 件。

⁴ WIPO 統計（2009 年）

（５）中国の発言力

このように、中国は知的財産権の創造・活用・保護・管理能力の向上を目標として積極的に政策を立案・遂行している。特許出願件数では世界第２位、商標出願件数では世界第１位の中国は、市場の大きさと出願数の多さから世界に対する発言力が増すと思われる。また、迅速で積極的な政策立案、グローバル企業の多くが中国で知財活動に従事している現状からみて、アジアにおける知財活動の中心となる可能性は小さくない。

２ 日本企業による中国の位置づけ

中国に対する日本企業の見方も変化している⁵。中期的（今後３年程度）な有望事業展開先国・地域を見ると中国が常時１位を占めているが、その有望理由をみると、「安価な労働力」が継続的に低下している反面、「現地マーケットの今後の成長性」は９割近くに達している。日本企業の多くが中国を巨大な市場として見ており、中国市場で製品を販売し、利益を上げることが日本企業にとって重要であることがわかる。そのため、中国市場に向けた製品開発が必要となり、外資企業が中国で設立する研究開発拠点も増えている⁶。日本企業としても、巨大な市場である中国において、自己の競争力を向上させるため、知的財産制度を適切に活用しなければならない。

３ 中国知財制度のあり方

日本企業が有する課題は数多く、多岐にわたっているが、中国知財制度のあるべき姿としては「研究開発成果・ブランドの適切な保護」と「適切な権利活用」である。そして、これらを阻害する差別的な政策を排除すること、また知的財産権を尊重する雰囲気在中国国民に醸成することも重要である。

（１）研究開発成果・ブランドの適切な保護

研究開発成果・ブランドを適切に保護するため、下記事項の改善が必要である。

① 的確で適時⁷な審査の実現（第三者による情報提供を含む）

⁵ 国際協力銀行「わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告」

⁶ 「2009 跨国公司中国報告」

⁷ SIPO の平均審査期間は JPO よりも速いが、更に早期の審査を希望する案件も存在する。

- ② 審査遅滞を招かない範囲での補正・訂正の許容（原語出願の許容を含む）
- ③ 技術の進展に対応した保護範囲の拡大（画面意匠の保護など）
- ④ 研究開発成果の適切な保護（妥当な権利範囲、秘密意匠、他人の意匠権との関係の明確化など）
- ⑤ 中国文献を含めた検索システムの構築と外部公開
- ⑥ 悪意に基づく商標登録の拒絶・取消（外国著名商標の保護を含む）
- ⑦ 馳名商標の適切な保護と認定手続きの柔軟化
- ⑧ 透明な審査・審理プロセスの確保

そして、経済活動がグローバル化する中、世界中で行われる研究開発の成果を的確に保護するため、特許制度調和の促進、ひいては世界共通特許の実現を目指していただきたい。

（２）適切な権利活用

権利活用を適切に行うため、そして模倣品対策を更に効果的に行うためには、下記事項の改善が必要である。

- ① 知的財産権の濫用防止（パテント・トロールへの懸念、無審査登録される実用新案権・意匠権など）
- ② 人民法院の判決の均一化と裁判官の資質向上（判決全ての速やかな公開など）
- ③ 不正競争行為の拡充と明確化
- ④ 国際的なライセンスを阻害する制度の見直し（ライセンサーに課せられた保証義務の削減、外国への送金手続きの簡易化、政府機関への登録義務の緩和など）
- ⑤ 外資企業に不利な制度・政策の排除
- ⑥ 繰り返される模倣行為の効果的な抑止（重罰化、刑事移送、価格認定の透明化など）
- ⑦ 巧妙化・複雑化する模倣行為への対応
- ⑧ 国務院レベルによる模倣品取締り活動の継続

上記課題を解決するためには、中国の法律・法規の改正が必要な事項も少なくない。これら課題の早期解決は難しいと思料するが、日中政府間における継続した交渉をお願いしたい。

他方、中国政府の運用改善、日本政府自身の代替策で対応が可能な事項については、優先的な解決を希望する。例えば、商標出願に対する情報提供制度の構築、人民法院の判決全ての公表、何人でも可能な出願書類の閲覧などが想定

そのため、日中間での特許審査ハイウェイ（PPH）の本格実施が望まれる。

される。また、日本語又は中国語による中国特許文献検索システムは、日本国特許審査官にとっても必要である。したがって、日本国特許庁が自ら当該システムを構築し、日本企業に公開することも検討していただきたい。

なお、模倣行為を許さない環境の整備を図るためには、中国国民に対する普及啓発活動も重要である。普及啓発活動は企業単独で行うことが難しいため、日本国政府による取り組みを期待したい。

4 外資企業の知財活動

中国で活動する日系企業は、北京、上海、広東の 3 拠点において IPG (Intellectual Property Group) を構成し、中国の経済発展と全世界の消費者保護のため、知的財産に関する課題の解決に積極的に取り組んでいる。IPG は現地企業の代表として、法律改正案に対する意見提出や中国政府との意見交換等を行っており、欧米企業の知財担当者が数多く集まる QBPC (Quality Brand Protection Committee) ⁸との連携も行っている。

他方、欧米企業は、QBPC や米国商会、欧商会としての活動のほか、自国政府に働きかけ、知的財産権問題をハイレベル政府間交渉の議題としている。

- ・ 米国 米中戦略・経済対話 (S&ED) ⁹
 米中合同商業貿易委員会 (JCCT) ¹⁰
 米中合同商業貿易委員会 IPRWG¹¹
- ・ 欧州 EU-China ハイレベル経済貿易対話¹²
 EU-China IP Dialogue¹³

⁸ 中国外商投資企業協会 (CAEFI) の下部機関。なお、CAEFI は中国商務部が所管する協会である。

⁹ 第三回は 2011 年 5 月 9 日～10 日にワシントンで開催され、中国は王岐山副首相がヘッド。Outcome として、知的財産権侵害を迅速に解決するための双方の努力に言及。

¹⁰ 米中間の通商問題を議論する年 1 回開催の閣僚級会合。米国側は通商問題の特定・解決並びに通商機会の拡大の場として利用。1983 年に設置され 2004 年から閣僚級に格上げされている。

¹¹ JCCT の下には多くの WG があり、その 1 つが IPRWG である。

¹² 第三回は 2010 年 12 月 20 日～21 日に北京で開催され、中国は王岐山副首相がヘッド。議題の一つが知的財産権であり、模倣品特別プロジェクト活動や特許の質等が議論された。

¹³ EU-China ハイレベル経済貿易対話の枠組みの下に 35 の Dialogue が設けられており、その一つが IP Dialogue である。

EU－China IP Working Group¹⁴

国務院主導の「知的財産権の侵害及び模倣品・粗悪品の製造・販売を摘発する特別プロジェクト活動」が成果を上げているように、中国ではトップダウンによる命令が非常に効果的である。日本としても、日中のハイレベル政策対話の機会をより一層活用し、具体的な知的財産問題を議論していただきたい。

(了)

¹⁴ EU-China IP Dialogue において創設された WG である。IP Dialogue を補完すること、産業界及び権利者の参加を可能とすることを目的とし、欧州の産業界及び権利者が中国で直面する課題について交流することにより、知財における中国との関係強化を図る。